



(19) Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 1 006 389 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
07.06.2000 Patentblatt 2000/23

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: G02B 13/24

(21) Anmeldenummer: 99121205.1

(22) Anmeldetag: 23.10.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 30.11.1998 DE 19855108

(71) Anmelder:  
• Carl Zeiss  
89518 Heidenheim (Brenz) (DE)  
Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR NL

• Carl-Zeiss-Stiftung trading as Carl Zeiss  
89518 Heidenheim (Brenz) (DE)  
Benannte Vertragsstaaten:  
GB

(72) Erfinder:  
• Schuster, Karl-Heinz  
89551 Königsbronn (DE)  
• Beierl, Helmut  
89522 Heidenheim (DE)

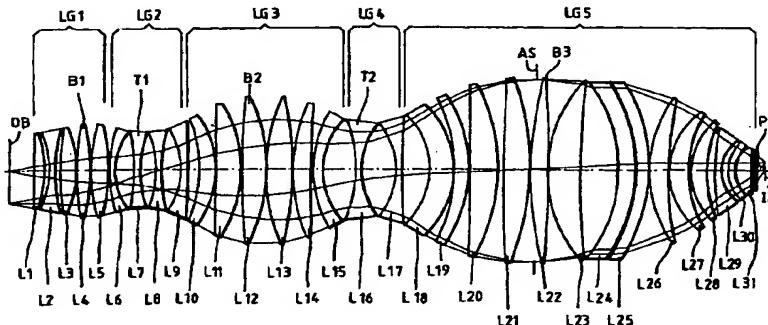
(54) Mikrolithographisches Reduktionsobjektiv, Projektionsbelichtungsanlage und -Verfahren

(57) Mikrolithographisches Projektionsobjektiv mit einer Linsenanordnung, bestehend aus

einer ersten Linsengruppe (LG1) positiver Brechkraft,  
zweiten Linsengruppe (LG2) negativer Brechkraft,  
dritten Linsengruppe (LG3) negativer Brechkraft,  
vierten Linsengruppe (LG4) negativer Brechkraft und  
fünften Linsengruppe (LG5) positiver Brechkraft  
wobei  
die Systemblende (AS) in der fünften Linsengruppe

(LG5) liegt und mindestens zwei Linsen dieser Linsengruppe (LG5) vor der Systemblende (AS) liegen. Dabei ist vorgesehen, daß die bildseitige numerische Apertur größer als 0,65 ist (in Beispielen bis 0,8), oder daß diese Linsengruppe (LG5) mindestens 13 Linsen (L18 - L31) aufweist, oder daß die Systemblende (AS) im Bereich der Linse (L22), an der das Lichtbündel den größten Durchmesser annimmt, und ihrer beiden benachbarten Linsen (L21, L23) angeordnet ist.

FIG. 1



## EP 1 006 389 A2

### Beschreibung

[0001] Das gattungsgemäße mikrolithographische Reduktionsobjektiv nach dem Oberbegriff des Anspruch 1 ist ein rein refraktives Hochleistungsobjektiv, wie es für die hochauflösende Mikrolithographie besonders im DUV-Wellenlängenbereich benötigt wird.

[0002] Derartige refraktive Objektive mit zwei Strahltaillen sind schon in dem Artikel von E. Glatzel „New lenses for microlithography“ SPIE, Vol. 237, 310 (1980) beschrieben und seitdem ständig weiterentwickelt worden. Gattungsgemäße Objektive der Firma Carl Zeiss werden in Wafer-Steppern und Wafer-Scannern PAS der Firma ASML, Niederlande, verkauft.

[0003] Ein derartiges Objektiv der Firma Tropel aus dem Jahre 1991 ist in Figur 16 von J.H. Bruning „Optical Lithography - Thirty years and three orders of magnitude“ SPIE, Vol 3049, 14-27 (1997) gezeigt. Zahlreiche Varianten gattungsgemäßer Projektionsobjektive finden sich in Patentanmeldungen, so EP 0 712 019-A (US Ser. 337 647 v. 10. Nov. 1994), EP 0 717 299-A, EP 0 721 150-A, EP 0 732 605-A, EP 0 770 895-A, EP 0 803 755-A (US 5,781,278), EP 0 828 172-A.

[0004] Ähnliche Objektive mit noch etwas kleinerer numerischer Apertur finden sich auch in SU 1 659 955-A, EP 0 742 492-A (Fig. 3) US 5,105,075 (Fig. 2 und 4), US 5,260,832 (Fig. 9) und DD 299 017-A.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Objektivtyp anzugeben, der im Umfeld des bekannten Stands der Technik durch hohe Auflösung bei großem Bildfeld und kleiner Baulänge hervorragt und dessen Bildfehlerkorrektur, besonders hinsichtlich der Verzeichnung, auch mit verschiedenen Beleuchtungsarten (verschiedener Kohärenzgrad usw.) 20 und bei deutlichem Abblenden (für Belichtungen mit größerem Schärfentiefenbereich) stabil bleibt.

[0006] Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einem Objektiv nach einem der Ansprüche 1, 2 und 11.

[0007] Die Blende wird in die fünfte Linsengruppe im Bereich des dritten Bauchs des Lichtbündels verlegt. Insgesamt erhält diese fünfte Linsengruppe und die Einbindung der Systemblende mehr Bedeutung. Die beim Stand der Technik teilweise der Ausbildung der Taillen, speziell der ersten, gewidmete Aufmerksamkeit wird dann weitgehend 25 bedeutungslos, wie die Ausführungsbeispiele zeigen.

[0008] Die hohe numerische Apertur als primäres Mittel zur Erzielung hoher Auflösung strapaziert das Design im wesentlichen zwischen Systemblende und Bildebene, besonders wenn Baulänge und Linsendurchmesser einigermaßen klein bleiben sollen, was insbesondere für eine leichte Integration in vorhandene Konzepte von Projektionsbelichtungsanlagen und für die Fertigung, sowie auch aus Kostengründen stark bevorzugt wird.

[0009] Demgemäß geben die Unteransprüche 3 bis 9 und 12 vorteilhafte Ausführungsformen der fünften Linsengruppe an.

[0010] Unteranspruch 10 betrifft die besonders vorteilhafte Abblendbarkeit des Objektivs, die durch jeweils einzelne Minimierung der verschiedenen Bildfehler erreicht wird. Dies wird wiederum mit dem Designkonzept der Erfindung ermöglicht. Anders als bei einem Objektiv mit fester Apertur können nicht verschiedene große Fehler subtraktiv 35 ausgemittelt werden. Der Vorteil ist, daß der Anwender das trade-off von Auflösung und Schärfentiefe jeweils bezogen auf den Anwendungsfall optimieren kann.

[0011] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche 13 bis 16. Eine Projektionsbelichtungsanlage nach den Ansprüchen 17 oder 18 ergibt die optimale Anwendung dieser Objektive und zeichnet sich durch große Anwendungsbreite aus. Besondere Bedeutung hat die nach Anspruch 18 erreichte große Toleranz der 40 Abbildungsleistung gegen Änderungen des Beleuchtungssettings.

[0012] Das Herstellverfahren nach Anspruch 19 macht von der hervorragenden Korrektur des Objektivs durch flexible Beleuchtungs- und Apertureinstellung bei verschiedenen im Herstellprozess aufeinanderfolgenden Belichtungen Gebrauch. Die einzelnen Belichtungen können dabei auf einer Projektionsbelichtungsanlage mit verschiedenen Masken erfolgen, oder es können mehrere erfindungsgemäße Projektionsbelichtungsanlagen - auch in Kombination mit 45 anderen - in einer Fertigungsline genutzt werden.

[0013] Näher erläutert wird die Erfindung anhand der Zeichnung.

[0014] Dabei zeigen:

50 Figur 1 den Linsenschnitt eines ersten Ausführungsbeispiels;

Figur 2 den Linsenschnitt eines zweiten Ausführungsbeispiels;

Figur 3 den Linsenschnitt eines dritten Ausführungsbeispiels;

55 Figur 4a-c die Queraberrationen im Sagittalschnitt für verschiedene Bildhöhen zu Figur 1;

Figur 5a-c die Queraberrationen im Meridionalschnitt für verschiedene Bildhöhen zu Figur 1;

## EP 1 006 389 A2

Figur 6 den Linsenschnitt eines vierten Ausführungsbeispiels; und

Figur 7 schematisch ein Beispiel einer erfindungsgemäßen Projektionsbelichtungsanlage.

5 [0015] Entsprechend dem primären Bedarf für ein erfindungsgemäßes Projektionsobjektiv sind die Beispiele der Figuren 1 bis 3 und 6 für den Betrieb mit einem in der DUV-Mikrolithographie üblichen Excimer-Laser von 248, 38 nm Wellenlänge ausgelegt und enthalten ausschließlich Quarzglas-Linsen. Ihre Schnittweite liegt mit 1000 mm für Figuren 2, 3 und 6 bis 1150 mm bei Figur 1 am unteren Ende des Gebräuchlichen und des Machbaren. Die numerische Apertur von 0,70 (bei den Figuren 2,3 und 6) und 0,80 bei Figur 1 liegt deutlich über dem vorbekannten, zeigt die Potenz des erfindungsgemäßen Designs und erlaubt die Ausführung der Mikrolithographie mit Auflösungen bis herunter zu 0,18 µm und weniger unter Serien-Produktionsbedingungen. Solche Auflösungen galten noch vor kurzem als überhaupt nicht mit der optischen Lithographie zugänglich.

[0016] Mit einer Bildhöhe  $2Y_B = 27,2$  mm ergibt sich so bei  $NA = 0,70$  der sehr hohe Lichtleitwert von  $LLW = NA \cdot 2 Y_B = 19,04$ . Das Objektiv ist damit für einen Scanner mit einem  $8 \times 26 \text{ mm}^2$  Bildfeld geeignet.

10 [0017] Beachtlich ist dabei, daß die Steigerung der bildseitigen numerischen Apertur von 0,63 schon zu dem erreichten Wert von 0,70 (Fig. 2, 3, 6) wesentlich schwieriger ist als etwa die Steigerung von 0,45 zu 0,6, da bekanntlich bei  $NA = 1,0$  in Luft alle Bildfehler einen Pol erreichen und entsprechend bei Annäherung an diesen Wert immer stärker ansteigen bzw. immer schwerer zu korrigieren sind. Das Beispiel der Figur 1 zeigt also mit  $NA = 0,8$  eine hervorragende Konstruktion.

15 [0018] Die Linsendaten des Ausführungsbeispiels nach Figur 1 sind in Tabelle 1 angegeben. 31 Linsen L1 bis L31 und eine Planplatte P1 sind vorgesehen. P1 dient als leicht tauschbares waferseitiges Abschlußfenster.

[0019] Der erreichte RMS-Fehler von unter  $13 \text{ m}\lambda$  über alle Bildhöhen zeigt eine hervorragende Abbildungsleistung.

20 [0020] Die Linsen L1 bis L5 bilden die erste Linsengruppe LG1 mit dem ersten Bauch B1 des Lichtbündels an der Rückfläche der Linse L4. Eine negative Linse L2 leistet die erforderliche Strahlauflaufweitung.

[0021] Die Linsengruppe LG2 aus den negativen Linsen L6 bis L9 bildet an der Rückfläche der Linse L7 die erste Taille T1. Typisch für diese Linsengruppe LG2 sind die zur Taille konkaven Menisken L6 und L9.

25 [0022] Die dritte Linsengruppe LG3 besteht aus den fünf positiven Linsen L10 bis L14, deren äußere L10 und L14 jeweils als außenseitig konkave Menisken ausgebildet sind, sowie dem negativen bildseitig konkaven Meniskus L15. An der Rückfläche der Linse L12 ist der zweite Bauch B2 mit dem örtlich maximalen Lichtbündeldurchmesser ausgebildet.

[0023] Die vierte Linsengruppe LG4 besteht aus zwei Negativlinsen L16 und L17. An der Rückfläche der Linse L16 ist die zweite Taille T2 ausgebildet. Hier ist eine starke bikonvexe Luftpflinse ausgebildet.

30 [0024] Die fünfte Linsengruppe LG5 mit den 14 Linsen L18 bis L31 ist für das erfindungsgemäße Objektiv am bedeutendsten.

[0025] Vor der Linse L22 ist die Systemblende AS angeordnet. An der Vorderfläche der folgenden Linse L22 ist der dritte Bauch B3 mit seinem gegenüber dem Blendendurchmesser (306,3 mm). nur geringfügig größeren Lichtbündeldurchmesser (308,0 mm) ausgebildet.

[0026] Erfindungsgemäß erfolgt die Strahlumlenkung im Bereich des Bauchs B3 durch eine Mehrzahl beidseits der Blende AS angeordneter mäßig stärker und damit ziemlich dünner Positivlinsen L19 bis L23. Damit wird die sphärische Unterkorrektur in diesem Bereich minimiert und gleichzeitig die Baulänge gegenüber dem Einsatz weniger, aber starker und dicker Linsen verringert.

35 [0027] Auch die Variation der Bildfehler beim Abblenden oder bei verschiedenen Beleuchtungs-Einstellungen wird durch diese Maßnahme verringert. Bei den beiden im divergenten Strahlengang stehenden Linsen L19 und L20 erhält letztere mehr Brechkraft. Die Linsen L21 und L22 zeigen gleichmäßig verteilte Brechkraft, der Strahlengang zwischen den beiden ist nahen parallel. Die Linsen 21 bis 23 übernehmen einen erheblichen Teil der Systembrechkraft bei kleinstmöglicher Erzeugung von sphärischer Überkorrektur und entspannen die Problematik der Abhängigkeit der Fehlerkorrektur von numerischer Apertur und Beleuchtungsart (NA-Sigma-Problem). Somit sind hervorragende Abbildungseigenschaften bei den verschiedensten Beleuchtungseinstellungen und Apertureinstellungen erreichbar.

40 [0028] Die erste Linse L18 der fünften Linsengruppe LG5 ist ein schwach brechender dicker objektseitig konkaver Meniskus. Hier wäre eine Aufteilung durch eine sphärisch überkorrigierende Luftpflinse zwar entspannend für die Korrektionswirkung der folgenden Linsen, würde aber die Baulänge unvorteilhaft vergrößern.

[0029] Die Linse L24 bildet mit der nur durch einen dünnen Luftsput getrennten folgenden bikonvexen Linse L25 im wesentlichen einen schwach brechenden dicken Meniskus. Er balanciert durch sphärische Überkorrektur die entsprechende Wirkung der vorangehenden Linsen L18 bis L23. Die Aufspaltung in die zwei Teile L24 und L25 bringt hier wiederum die kürzeste Baulänge. Beide sind die einzigen Linsen bildseitig der Systemblende AS, die objektseitig konkav sind.

45 [0030] Der genau umgekehrte Vorzug von dicker Linse L18 und aufgespaltenem Meniskus L24, L25 erklärt sich

## EP 1 006 389 A2

aus den unterschiedlichen Umgebungen und Arbeitsbereichen der Menisken. L18 steht wenig belastet im divergenten Strahlengang. Alle Strahlen durchlaufen die Linsenflächen weitgehend normal. Der Meniskus L18 wirkt in erster Linie als Petzval-Element und drückt die Petzvalsüme des Objektivs. Diese Funktion kann jedoch auch umverteilt werden, so daß die Dicke reduziert sein kann.

5 [0031] Der aufgespaltene Meniskus L24, L25 steht im Gegensatz dazu im konvergenten Strahlengang und ist mittel bis stark belastet. Er übernimmt allein die Aufgabe der sphärischen Überkorrektur der näheren Umgebung. Bei ein-  
teiliger Ausführung bedingt dies eine beachtliche Dicke. Die Aufspaltung des Meniskus durch einen wenig belasteten  
Lufräum schafft die Entkopplung von Meniskusradien und Meniskusdicke. Dadurch gelingt es, beide Linsen L24, L25  
aufgeringe Dicke zu setzen und die Gesamtdicke zu senken.

10 [0032] Die beiden negativen Menisken L29 und L30 mit der abschließenden Sammellinse L31 werden in der Lite-  
ratur teilweise auch als sechste Linsengruppe bezeichnet.

[0033] Die Korrektur der sagittalen schießen sphärischen Aberration bereitet bei Aperturerhöhung besondere Pro-  
bleme. Durch die obengenannten Maßnahmen im Blendenbereich werden diese bereits gemildert, aber noch nicht  
gelöst. Im feldwirksamen Bereich zwischen Blende AS und Bild IM wird zur Korrektur der sagittalen schießen sphäri-  
schen Aberration eine Erhöhung der Einzelbrechkräfte von Plus- (L26, L27, L28, L31) und Minuslinsen (L29, L30) vor-  
gesehen. Das Mittel der Wahl ist damit die Korrektion durch Kompensation der Bildfehler höherer Ordnung. Allerdings  
ist dies auch für die relativ großen Durchmesser der Linsen L19 bis L25 im Blendenraum verantwortlich. Die Brechkraft  
der Negativlinse L29 ist also hoch, drei vorangestellte Positivlinsen L26 bis L28 erlauben die verteilte Bereitstellung der  
entsprechenden positiven Brechkraft. Durch den bei drei Linsen großen Freiraum hinsichtlich der Durchbiegung der  
20 Linsen wird es möglich, die Sinus i-Winkel der Komastrahlen hier jeweils unter dem Wert der hohen numerischen Aper-  
tur von 0,80 zu halten. Die starke Durchbiegung des negativen Meniskus L29 ergibt vor und hinter ihm sphärisch über-  
korrigierende Lufräume.

[0034] Die Korrektur der Bildfehler außerhalb der Hauptschnitte wird durch die gesteigerte Apertur ganz erheblich  
erschwert. Zu ihrer Korrektur wird die Abstimmung der Brechkräfte in der dritten Linsengruppe LG3 im Bereich des  
25 zweiten Bauchs B2 optimiert. Das Linsenpaar L14 und L15 lenkt das Strahlbündel in die zweite Taille T2 und schafft  
damit in platzsparender Weise ebenso wie Linse L18 einen günstigen Beitrag zur Petzvalkorrektur. Die positiven Linsen  
L10 bis L13 der dritten Linsengruppe LG3 und die negative Linsengruppe LG4 werden dadurch von Brechkraft entla-  
stet.

[0035] Die positive Brechkraft von L14 verbessert die Bildfehler betrachtet im 45°-Schnitt durch die Apertur. Durch  
30 die negative Brechkraft von L15 wird die negative vierte Linsengruppe LG4 mit den sphärisch überkorrigierenden Lin-  
sen L16 und L17 entlastet, wodurch Zonenfehler in Apertur und Feld reduziert werden.

[0036] Zwei Einzellinsen L14, L15 sind hier einem dicken Meniskus klar vorzuziehen: Zum einen kann wie darge-  
stellt die Bildfehlerkorrektur substantiell verbessert werden, zum anderen wird die Kühlung der Linsen, was bei dem  
schlitzförmigen Feld von Scannern und der nicht vernachlässigbaren Absorption bei hoher Strahlungsleistung ein als  
35 „lens heating“ bekanntes Problem ist (besonders bei 193nm), verbessert.  
Diese Merkmale sind auch bei den folgenden Ausführungsbeispielen entsprechend zu finden.

[0037] Die weiteren Ausführungsbeispiele Fig. 2 und 3 sowie 6 sind bei mäßig hoher Apertur NA = 0,7 ausgeführt.  
Die Schnittweiten reduzieren sich dabei auf 1000 mm. Das zweite Ausführungsbeispiel nach Figur 2 und Tabelle 2  
zeigt, daß das Design gegenüber Änderungen in den ersten beiden Linsengruppen LG1 und LG2 weitgehend stabil ist.

40 In der ersten Linsengruppe LG1 haben die ersten beiden Linsen 201 und 202 gegenüber Figur 1 einen Platzwechsel  
vorgenommen. In der zweiten Linsengruppe LG2 ist eine positive Linse 207 zwischen die negativen Linsen 206 und  
208 bis 210 eingeschoben. Die Ausbildung dieser Linsengruppe LG2 mit oder ohne Positivlinse wird im Stand der Tech-  
nik vielfach als wichtig dargestellt, so in EP 0 770 895-A (ohne) und EP 0 717 299-A (mit).

[0038] Insbesondere die fünfte Linsengruppe zeigt die gleichen qualitativen Merkmale, durch die reduzierte Aper-  
45 tur sind aber die Linsendurchmesser wesentlich reduziert.

[0039] Gegenüber dem Meniskuspaar L24/L25 ist hier bei den Linsen 225, 226 der dünne Luftspalt deutlich weni-  
ger gekrümmt. Der bei L24/L25 zu Figur 1 beschriebene Haupteffekt der sphärischen Überkorrektur bleibt erhalten.

[0040] Das dritte Ausführungsbeispiel nach Figur 3 und Tabelle 3 zeigt die erste Linsengruppe wie Beispiel 2. Die  
50 zweite Linsengruppe LG2 zeigt die Positivlinse 308 nunmehr in die Mitte zwischen die je zwei Negativlinsen 306, 307  
und 309, 310 gewandert.

[0041] Die fünfte Linsengruppe LG5 ist jetzt durch Zusammenfassen der Linsen L24 und L25 der Figur 1 zum dik-  
ken Meniskus 325 um eine Linse auf 13 Linsen reduziert. Mit dieser Anordnung ist ebenso wie bei einer Aufteilung des  
Meniskus in die zwei Linsen L24 und L25 eine gleich gute Abbildungsleistung möglich.

[0042] Bei beiden Ausführungsbeispielen nach Figuren 2 und 3 ist außer der Abschluß-Planplatte P2 noch eine  
55 blendennahe Planplatte P1 vorgesehen. Diese kann z.B. als Apodisations-Filter genutzt werden.

[0043] Die erreichte gute Bildfehlerkorrektur soll für das Beispiel der Figur 1 näher dargestellt werden. Figuren 4a  
bis 4c zeigen die sagittale Querabweichung DZS als Funktion des halben Aperturwinkels DW für die Bildhöhen 13,6 ,  
9,6 und 0 mm. Figuren 5a bis 5c zeigen die entsprechenden Meridionalschnitte DYM.

## EP 1 006 389 A2

[0044] In Tabelle 4 ist die Verzeichnung des Hauptstrahls Vhs für verschiedene Bildhöhen (in Bruchteilen der maximalen Bildhöhe  $Y' = 13,6 \text{ mm}$ ) angegeben. Sie liegt für alle Bildhöhen bei maximal 1,5 nm.

[0045] Tabelle 5 gibt die Abweichung der Verzeichnung  $\Delta V$  von diesem Vhs für verschiedene Einstellungen der numerischen Apertur NA und des Kohärenzgrads Sigma. Ringaperturbeleuchtungen mit den Werten von 0,35-0,70 und 0,50-0,85 von Sigma sind ebenfalls berücksichtigt. Der Größtwert dieser Abweichung ist 4,7 nm, überwiegend liegen die Werte unter 3 nm.

[0046] Insgesamt liegt die Verzeichnung also überall und mit allen Einstellungen unter 10nm, sogar unter 6nm und überwiegend noch darunter. Dabei sind diese Werte im Zusammenhang mit der sehr hohen NA von 0,8 dieses Objektivs zu sehen. Bei kleinerer NA lassen sich erheblich kleinere Verzeichnungen realisieren..

[0047] Es zeigt sich also eine sehr gute Stabilität dieses Designs gegen Änderungen der ausgenutzten Apertur NA (abblenden) und Verändern des Beleuchtungs-Settings (Sigma).

[0048] Das weitere Ausführungsbeispiel nach Figur 6 und Tabelle 6 unterscheidet sich von den vorangehenden Beispielen hauptsächlich durch eine minimierte Variation der realen Blendenlage von 25 mm auf jetzt 15 mm. Dies wurde dadurch erreicht, daß das gekrümmte Bild (Blende) der Pupille durch gezielte Korrektion des Astigmatismus im Tangentialschnitt teilweise kompensiert wurde. Damit kann eine Abblendung ohne Lageänderung der Blende AS ausgeführt werden. Der Abbildungsmaßstab ist 1:4, die numerische Apertur ist NA = 0,70.

[0049] Insgesamt entspricht der Aufbau weitgehend dem Beispiel der Figur 1. Der Luftspalt zwischen den Linsen 624 und 625 ist nur wenig gekrümmt.

[0050] Figur 7 gibt einen Überblick über ein Beispiel einer Projektionsbelichtungsanlage mit erfundungsgemäßem Projektionsobjektiv. Ein geeignetes Beleuchtungssystem B ist beispielsweise aus EP 0 747 772-A (US Ser. No. 08/658,605) bekannt.

[0051] Der Laser 1 ist ein in der Mikrolithographie im tiefen Ultraviolet (DUV) gebräuchlicher KrF-Excimer-Laser mit 248nm Wellenlänge.

[0052] Ein Strahlauflänger 14, z.B. eine Spiegelanordnung nach DE-A 41 24 311, dient zur Kohärenzreduktion und Vergrößerung des Strahlquerschnitts.

[0053] Ein erstes diffraktives optisches Rasterelement 9 bildet die Objektebene eines Objektivs 2, in dessen Austrittspupille ein zweites diffraktives optisches Rasterelement 8 vorgesehen ist.

[0054] Eine Einkoppeloptik 4 überträgt das Licht auf die Eintrittsfläche 5e eines Glasstabs 5, der durch mehrfache innere Reflexion das Licht mischt und homogenisiert. Unmittelbar an der Austrittsfläche 5a ist eine Zwischenfeldebene, in der ein Reticle-Masking-System (REMA) 51, eine verstellbare Feldblende, angeordnet ist. Das nachfolgende REMA-Objektiv 6, mit Linsengruppen 61, 63, 65, Umlenkspiegel 64 und Pupillenebene 62 bildet die Zwischenfeldebene des Reticle-Masking-Systems 51 auf das Reticle 7 ab.

[0055] Bei einem Wafer-Scanner wird auf dem Reticle 7 ein schmaler Streifen, ein Rechteck mit einem Aspektverhältnis von 1 : 2 bis 1 : 8, beleuchtet und durch Scannen das gesamte strukturierte Feld eines Chips seriell beleuchtet. Die Beleuchtung ist extrem gleichmäßig und randscharf (nur in Richtung senkrecht zur Scanrichtung) zu gestalten.

[0056] Die Ausführung der dem Glasstab 5 vorgelagerten Teile, insbesondere der optischen Rasterelemente 8 und 9, ist so gewählt, daß die Eintrittsöffnung 5e nicht nur möglichst homogen, sondern auch mit höchstmöglichen Wirkungsgrad, d.h. ohne wesentliche Lichtverluste neben der Eintrittsöffnung 5e, ausgeleuchtet wird.

[0057] Wie in DE 44 21 053 beschrieben, ist das Objektiv 2 ein Zoom-Objektiv (bewegliche Linse 22) mit integriertem verstellbarem Axicon-Paar 21. Die Brennweite hat einen dreifachen Dehnungsbereich, so daß partiell kohärente Beleuchtung mit üblichen Werten von ca.  $0,3 \leq \sigma \leq 0,9$  erzeugt werden kann.

[0058] Durch Verstellen des Axicon-Paares 21 lassen sich zudem angepaßte Ringaperturbeleuchtungen einstellen. Durch zusätzliche Blenden oder spezielle Pyramidenform des Axicon-Paares 21 lassen sich zudem Sonderformen der Beleuchtung erzeugen.

[0059] Zwischen Reticle (Maske) 7 und Wafer 9, jeweils mit Scan-Einrichtung 71, 91 und den bekannten Hilfseinrichtungen, ist das erfundungsgemäße Projektionsobjektiv P mit den Linsengruppen P1 bis P5 angeordnet.

## EP 1 006 389 A2

Tabelle 1

5

	No.	r (mm)	d (mm)	H <sub>max</sub> (mm)
10	0b		20,147	
	L1	-2471,057	13,126	Quarzglas
		-247,584	7,640	
15	L2	-163,307	10,000	Quarzglas
		327,943	7,757	
20	L3	662,693	22,614	Quarzglas
		-209,088	,750	
25	L4	350,222	21,378	Quarzglas
		-416,285	,750	76,9
30	L5	265,534	26,426	Quarzglas
		-413,278	,750	
35	L6	197,069	10,000	Quarzglas
		111,439	26,308	
40	L7	-583,382	10,000	Quarzglas
		166,249	24,524	63,0
45	L8	-200,161	10,000	Quarzglas
		362,426	28,860	
50	L9	-126,683	12,696	Quarzglas
		-1228,324	16,242	
55	L10	-227,900	23,521	Quarzglas
		-170,208	,750	
60	L11	47071,771	38,438	Quarzglas
		-233,889	,750	
65	L12	987,385	38,363	Quarzglas
		-316,598	,750	123,3
70	L13	332,464	39,596	Quarzglas
		-738,425	1,005	

55

**EP 1 006 389 A2**

	L14	270,193	25,935	Quarzglas
5		1414,789	2,982	
	L15	176,884	18,578	Quarzglas
		131,204	47,520	
10	L16	-248,290	10,000	Quarzglas
		146,085	49,811	
	L17	-130,140	10,000	Quarzglas
		1307,156	41,204	
15	L18	-132,994	35,292	Quarzglas
		-167,225	,813	
	L19	-328,933	24,010	Quarzglas
20		-237,606	,864	
	L20	17258,370	43,549	Quarzglas
		-329,484	9,091	
25	L21	2237,627	40,932	Quarzglas
		-473,604	10,000	
	AS		,750	
30	L22	632,745	28,431	Quarzglas
		-3192,952	,750	
	L23	259,148	45,432	Quarzglas
35		1097,996	57,012	
	L24	-268,055	24,571	Quarzglas
		-312,384	,902	
40	L25	-334,579	23,847	Quarzglas
		-288,740	,750	
	L26	226,326	28,117	Quarzglas
		547,657	,750	
45	L27	122,960	34,861	Quarzglas
		225,966	,750	
	L28	117,965	21,109	Quarzglas
50		174,068	13,226	
	L29	348,448	10,000	Quarzglas

**EP 1 006 389 A2**

		60,716	11,148	
5	L30	73,830	10,069	Quarzglas
		55,083	,750	
10	L31	49,652	24,194	Quarzglas
		358,744	4,390	
15	P1	$\infty$	2,492	Quarzglas
		$\infty$	13,082	
	IM			13,6

20

25

30

35

40

45

50

55

Tabelle 2

5

	No.	r (mm)	d (mm)
10	0b		16,403
	201	-135,127	8,261
		444,747	6,467
15	202	2236,824	25,206
		-162,634	,750
20	203	614,107	18,869
		-359,473	,767
25	204	296,810	20,742
		-800,016	,828
30	205	273,478	21,990
		-784,045	,753
35	206	158,758	15,580
		92,816	26,614
40	207	-5054,350	11,927
		-272,904	2,399
45	208	-324,986	6,943
		136,767	20,167
50	209	-260,466	7,605
		192,638	30,771
	210	-103,229	8,994
		-2019,310	13,398
55	211	-206,341	17,802
		-138,999	,751
	212	958,350	42,708
		-166,018	,750
	213	407,944	29,112
		-547,681	,750

55

**EP 1 006 389 A2**

	214	202,874	32,883	Quarzglas
5		-2504,913	1,264	
	215	211,073	13,084	Quarzglas
		294,918	1,324	
10	216	159,796	15,645	Quarzglas
		111,543	36,908	
	217	-255,208	10,239	Quarzglas
		127,421	40,141	
15	218	-120,165	9,745	Quarzglas
		1795,197	27,676	
	219	-127,485	34,689	Quarzglas
20		-146,296	1,681	
	220	-317,078	20,599	Quarzglas
		-245,933	,762	
25	221	3679,928	30,729	Quarzglas
		-292,519	,650	
	P1	$\infty$	5,009	Quarzglas
30		$\infty$	17,000	
	AS		25,000	
	222	801,236	27,052	Quarzglas
35		-632,990	,750	
	223	551,359	25,021	Quarzglas
		-1150,052	,751	
40	224	194,154	32,180	Quarzglas
		591,161	34,477	
	225	-287,051	10,385	Quarzglas
		3278,663	2,220	
45	226	3516,772	30,035	Quarzglas
		-295,907	,763	
	227	262,200	19,612	Quarzglas
50		1177,101	,822	
	228	99,415	26,707	Quarzglas

**EP 1 006 389 A2**

		191,643	,753	
5	229	105,014	16,537	Quarzglas
		128,146	12,829	
10	230	391,872	7,165	Quarzglas
		55,094	10,778	
15	231	78,459	12,612	Quarzglas
		56,684	,777	
20	232	46,211	22,360	Quarzglas
		632,773	2,119	
	P2	∞	1,935	Quarzglas
		∞		

IM

25

30

35

40

45

50

55

Tabelle 3

5

	No.	r (mm)	d (mm)	
10	0b		16,402	
	301	-129,495	8,261	Quarzglas
		498,546	5,177	
15	302	2910,308	25,398	Quarzglas
		-156,581	,050	
	303	634,336	18,854	Quarzglas
20		-347,330	,301	
	304	306,046	18,385	Quarzglas
		-737,998	,348	
25	305	271,858	21,701	Quarzglas
		-702,302	,776	
	306	156,163	17,879	Quarzglas
30		92,619	25,370	
	307	-2510,654	8,958	Quarzglas
		139,288	19,325	
35	308	-302,813	11,398	Quarzglas
		-154,794	5,090	
	309	-167,161	7,960	Quarzglas
40		178,376	32,638	
	310	-103,339	9,166	Quarzglas
		-1706,866	12,661	
45	311	-202,377	17,389	Quarzglas
		-140,454	,651	
	312	987,948	43,015	Quarzglas
		-166,809	,650	
50	313	410,646	29,373	Quarzglas
		-550,047	,651	

55

**EP 1 006 389 A2**

	314	205,772	33,049	Quarzglas
5		-2521,253	,6514	
	315	213,410	13,198	Quarzglas
		290,632	2,731	
10	316	163,855	18,894	Quarzglas
		111,910	36,126	
	317	-254,971	9,329	Quarzglas
		125,915	38,073	
15	318	-120,961	9,708	Quarzglas
		1713,294	25,896	
	319	-128,631	34,802	Quarzglas
20		-148,294	2,087	
	320	-321,227	19,897	Quarzglas
		-242,281	,618	
25	321	2663,658	30,600	Quarzglas
		-296,524	,681	
	P1	$\infty$	4,588	Quarzglas
30		$\infty$	17,000	
	AS			
	322	799,643	27,212	Quarzglas
35		-634,102	,705	
	323	524,124	26,037	Quarzglas
		-1088,912	,650	
40	324	194,184	32,260	Quarzglas
		593,348	32,929	
	325	-291,552	42,741	Quarzglas
		-300,355	,729	
45	326	262,260	19,800	Quarzglas
		1149,322	,701	
	327	101,103	27,117	Quarzglas
50		197,398	,637	
	328	105,683	17,553	Quarzglas

55

**EP 1 006 389 A2**

		131,192	11,164	
5	329	445,739	7,334	Quarzglas
		56,924	10,924	
10	330	78,549	13,969	Quarzglas
		56,171	1,161	
15	331	46,702	22,163	Quarzglas
		689,875	2,680	
20	P2	$\infty$	1,749	Quarzglas
		$\infty$	11,991	

IM

25

Tabelle 4

Vhs (nm)				
1/8	2/8	4/8	6/8	1
1,1	1,5	0,1	0,9	0,7

35

Tabelle 5

$\Delta V$ (nm)							
NA	Sigma	1/8	2/8	4/8	6/8	1	
0,80	0,35	3,6	2,2	1,3	3,9	-1,2	
0,80	0,50	3,3	2,2	1,3	3,2	-1,3	
0,80	0,70	3,0	1,6	0,1	1,7	-1,4	
40	0,80	0,90	2,5	0,7	-1,2	0,9	-0,7
	0,80	0,35-0,70	2,7	1,4	-0,3	0,8	-1,5
45	0,80	0,50-0,85	2,2	0,3	-2,0	-0,2	-0,6
	0,70	0,50	2,9	2,7	3,0	4,5	-1,8
50	0,70	0,70	2,6	2,1	1,7	2,7	-2,0
	0,70	0,90	2,5	1,5	0,6	1,7	-1,5
	0,70	0,35-0,70	2,6	2,0	1,4	2,0	-1,9
55	0,70	0,50-0,85	2,4	1,3	-0,1	0,6	-1,6
	0,60	0,70	3,3	3,6	4,2	4,7	-1,2

**EP 1 006 389 A2**

Tabelle 5 (fortgesetzt)

$\Delta V$ (nm)							
	NA	Sigma	1/8	2/8	4/8	6/8	
5	0,60	0,90	3,0	2,9	2,8	3,1	-1,7
	0,60	0,35-0,70	3,2	3,5	4,1	4,5	-1,3
	0,60	0,50 - 0,85	2,8	2,7	2,5	2,5	-2,1

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Tabelle 6

5

	No.	r (mm)	d (mm)	Glas
10	0b		36,005	
	601	-1823,618	15,518	Quarzglas
		-214,169	10,000	
15	602	-134,291	7,959	Quarzglas
		328,009	6,376	
20	603	783,388	26,523	Quarzglas
		-163,805	,600	
25	604	325,109	20,797	Quarzglas
		-499,168	1,554	
30	605	224,560	24,840	Quarzglas
		-403,777	,600	
35	606	142,336	9,000	Quarzglas
		86,765	23,991	
40	607	6387,721	7,700	Quarzglas
		148,713	21,860	
45	608	-185,678	8,702	Quarzglas
		237,204	30,008	
50	609	-104,297	9,327	Quarzglas
		-1975,424	12,221	
55	610	-247,819	17,715	Quarzglas
		-152,409	,605	
60	611	1278,476	40,457	Quarzglas
		-163,350	,778	
65	612	697,475	28,012	Quarzglas
		-346,153	2,152	
70	613	232,015	28,068	Quarzglas
		-3080,194	2,606	

55

**EP 1 006 389 A2**

	614	219,153	21,134	Quarzglas
5		434,184	9,007	
	615	155,091	13,742	Quarzglas
		103,553	34,406	
10	616	-207,801	8,900	Quarzglas
		131,833	35,789	
	617	-118,245	9,299	Quarzglas
		1262,191	27,280	
15	618	-121,674	42,860	Quarzglas
		-151,749	,825	
	619	-366,282	20,128	Quarzglas
20		-236,249	,838	
	620	2355,228	31,331	Quarzglas
		-296,219	2,500	
25	P61	$\infty$	6,000	Quarzglas
		$\infty$	12,554	
	<b>AS</b>			
30	621	774,283	29,041	Quarzglas
		-782,899	,671	
	622	456,969	28,257	Quarzglas
35		-1483,609	,603	
	623	227,145	30,951	Quarzglas
		658,547	36,122	
40	624	-271,535	15,659	Quarzglas
		-997,381	4,388	
	625	-1479,857	27,590	Quarzglas
45		-288,684	,604	
	626	259,988	22,958	Quarzglas
		1614,379	,600	
50	627	105,026	29,360	Quarzglas
		205,658	,600	
	628	110,916	16,573	Quarzglas

55

**EP 1 006 389 A2**

		139,712	13,012	
5	629	499,538	8,300	Quarzglas
		56,675	9,260	
10	630	75,908	17,815	Quarzglas
		51,831	,995	
15	631	43,727	19,096	Quarzglas
		499,293	2,954	
20	P62	$\infty$	2,000	Quarzglas
		$\infty$	12,000	

Im

**25 Patentansprüche**

1. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv mit einer Linsenanordnung, bestehend aus  
einer ersten Linsengruppe (LG1) positiver Brechkraft,  
zweiten Linsengruppe (LG2) negativer Brechkraft,  
dritten Linsengruppe (LG3) positiver Brechkraft,  
vierten Linsengruppe (LG4) negativer Brechkraft und  
fünften Linsengruppe (LG5) positiver Brechkraft  
dadurch gekennzeichnet, daß  
die bildseitige numerische Apertur größer als 0,65 ist, vorzugsweise größer als 0,68, die Systemblende (AS)  
in der fünften Linsengruppe (LG5) liegt und mindestens zwei Linsen dieser Linsengruppe (LG5)-vor der  
Systemblende (AS) liegen.
2. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv mit einer Linsenanordnung, bestehend aus einer ersten Linsengruppe (LG1) positiver Brechkraft, zweiten Linsengruppe (LG2) negativer Brechkraft, dritten Linsengruppe (LG3) positiver Brechkraft, vierten Linsengruppe (LG4) negativer Brechkraft und fünften Linsengruppe (LG5) positiver Brechkraft  
dadurch gekennzeichnet, daß die Systemblende in der fünften Linsengruppe (LG5) liegt, mindestens zwei Linsen (L18, L19, L20, L21) dieser Linsengruppe (LG5) vor der Systemblende (AS) liegen und diese Linsengruppe (LG5)  
mindestens 13 Linsen (L18 - L31) aufweist.
3. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Systemblende (AS) zwischen zwei Sammellinsen (L21, L22) angeordnet ist und bildseitig mindestens eine weitere Sammellinse (L23 ) unmittelbar folgt.
4. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Linse (L18) der fünften Linsengruppe (LG5) ein schwach brechender dicker objektseitig konkaver Meniskus ist.
5. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Systemblende (AS) genau eine objektseitig konkave Linse (225, 325) folgt.
6. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die objektseitig konkave

**EP 1 006 389 A2**

Linse (325) ein dicker Meniskus ist.

7. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die objektseitig konkave Linse (225) mit einem dünnen Luftspalt von einer Sammellinse (226) gefolgt wird.  
5
8. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Systemblende (AS) genau ein Paar objektseitig konkaver Linsen (L24, L26) folgt, welche mit einem dünnen Luftspalt voneinander getrennt sind.  
10
9. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Luftspalt objektseitig konkav ist. (Fig. 6)  
15
10. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß beim Abblenden bis zu 70 % der numerischen Apertur die Verzeichnung unterhalb von 10 nm, vorzugsweise unter 6 nm, bleibt.  
15
11. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv mit einer Linsenanordnung, bestehend aus  
20 einer ersten Linsengruppe (LG1) mit positiver Brechkraft,  
einen Bauch (B1) des Lichtbündels bildend,  
einer zweiten Linsengruppe (LG2) mit negativer Brechkraft,  
eine Taille (T1) des Lichtbündels bildend,  
einer dritten Linsengruppe (LG3) mit positiver Brechkraft,  
einen zweiten Bauch (B2) des Lichtbündels bildend,  
25 einer vierten Linsengruppe mit negativer Brechkraft,  
eine zweite Taille (T2) des Lichtbündels bildend,  
einer fünften Linsengruppe (LG5) mit positiver Brechkraft,  
einen dritten Bauch (B3) des Lichtbündels bildend,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
30 die Systemblende (AS) in der fünften Linsengruppe (LG5) angeordnet ist, und zwar im Bereich der Linse (L22),  
an der das Lichtbündel den größten Durchmesser annimmt, und ihrer beiden benachbarten Linsen (L21, L23).  
35
12. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Systemblende (AS) zwischen zwei Sammellinsen (L21, L22) der fünften Linsengruppe (LG5) angeordnet ist.  
40
13. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Linsengruppe (LG2) mindestens zwei negative Linsen (206, 208-210) und eine positive Linse (207) enthält.  
45
14. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1-13, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Linse (201) objektseitig konkav ist.  
50
15. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1-14, dadurch gekennzeichnet, daß im Bereich der vierten Linsengruppe (LG4) genau drei Negativ-Linsen (L15-L17) rund um die zweite Taille (T2) angeordnet sind.  
55
16. Mikrolithographisches Projektionsobjektiv nach mindestens einem der Ansprüche 1-15, dadurch gekennzeichnet, daß der Sinus des i-Winkels des Randstrahls ( $\sin i_{\text{Rand}}$ ) an allen Linsen vor der letzten objektseitigen Linse (L31) Meiner als die objektseitige numerische Apertur (NA) ist ( $\sin i_{\text{Rand}} < NA$ ).  
50
17. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie mit  
einer Lichtquelle (1), insbesondere einem DUV-Excimer-Laser,  
einem Beleuchtungssystem (B),  
einem Masken-Halte- und -Justiersystem (7, 71)  
einem Projektionsobjektiv (P) nach mindestens einem der Ansprüche 1-16 und  
einem Objekt-Halte- und -Justier-System (9, 91).  
55

**EP 1 006 389 A2**

18. Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Beleuchtungssystem (B) verschiedene Beleuchtungsarten, insbesondere mit verschiedenem Kohärenzgrad, erzeugt und das Projektionsobjektiv (P) bei den verschiedenen Beleuchtungsarten die Verzeichnung unterhalb von 10nm, vorzugsweise unterhalb von 6nm hält.
- 5 19. Herstellverfahren mikrostrukturierter Bauelemente unter Anwendung mehrerer mikrolithographischer Belichtungen mit einer Projektionsbelichtungsanlage mit den Merkmalen der Ansprüche 17 und 9, wobei bei verschiedenen Belichtungen verschiedene Beleuchtungsarten und/oder numerische Apertur eingestellt werden.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG. 1

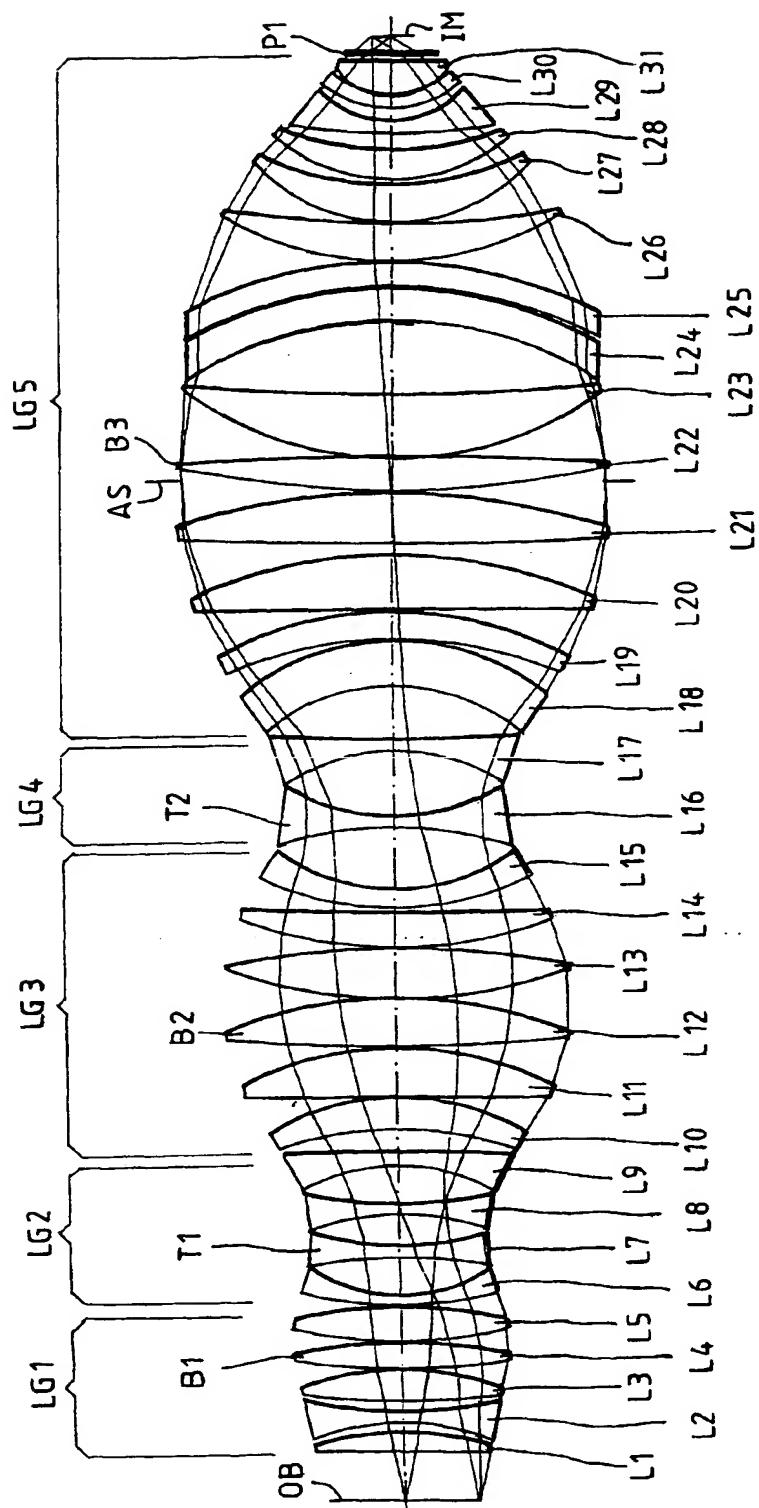


FIG. 2

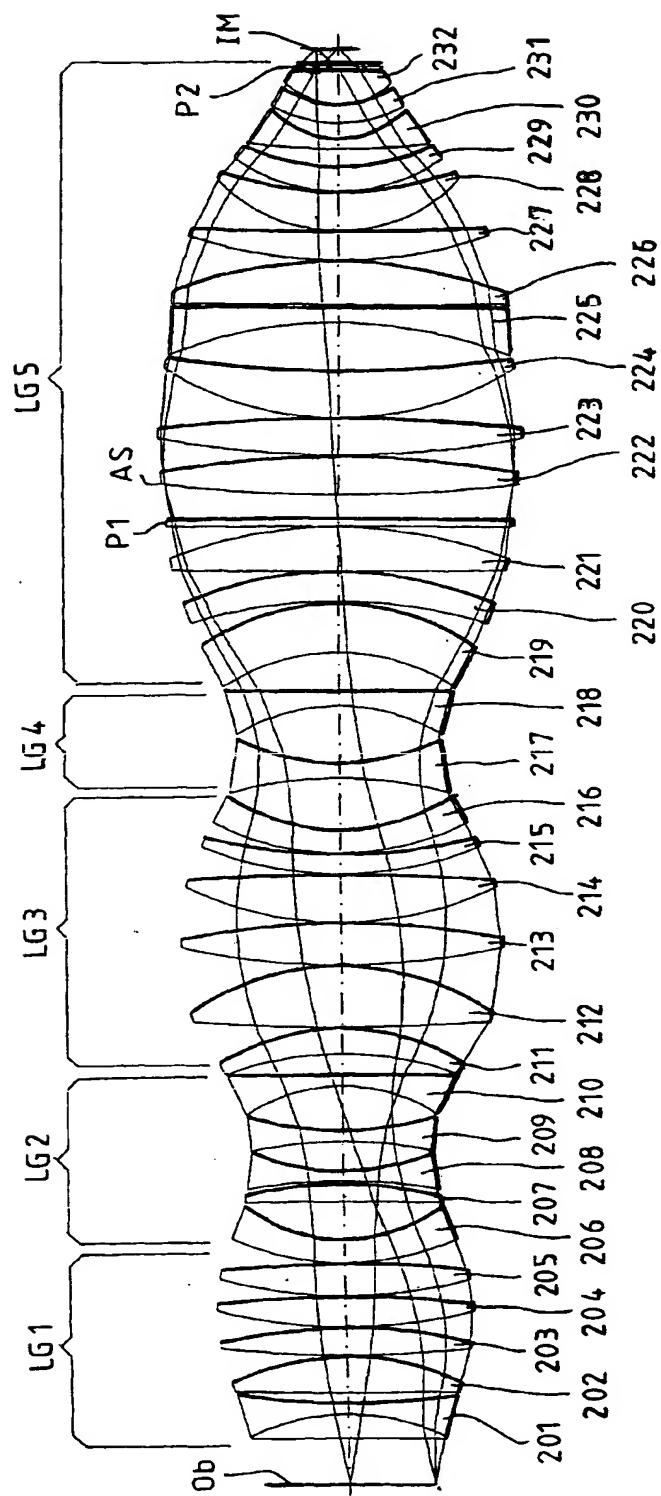


FIG. 3

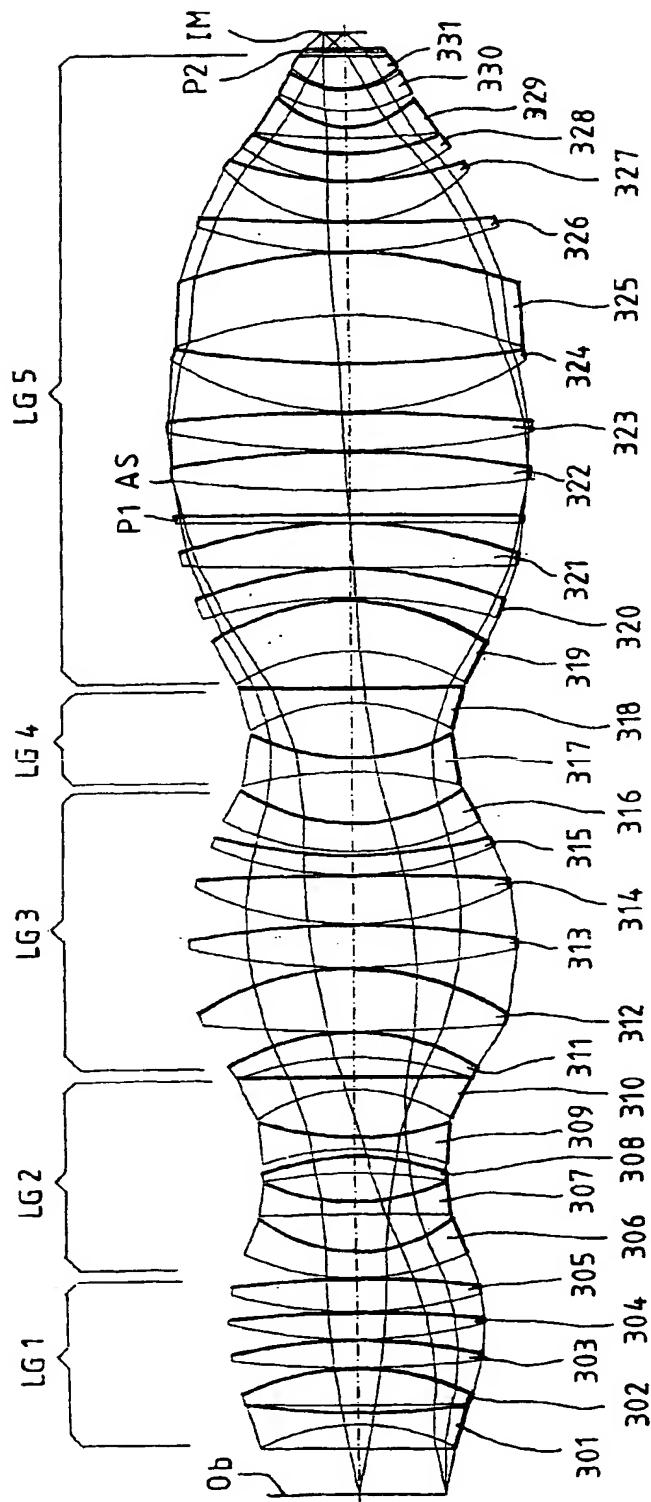


FIG. 4a

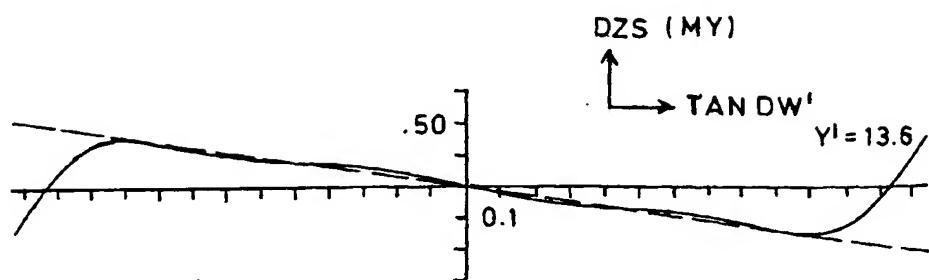


FIG. 4b

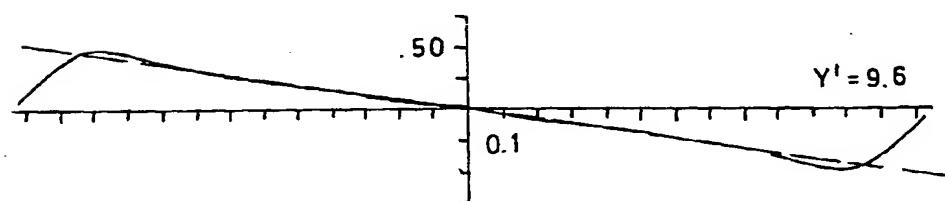


FIG. 4c

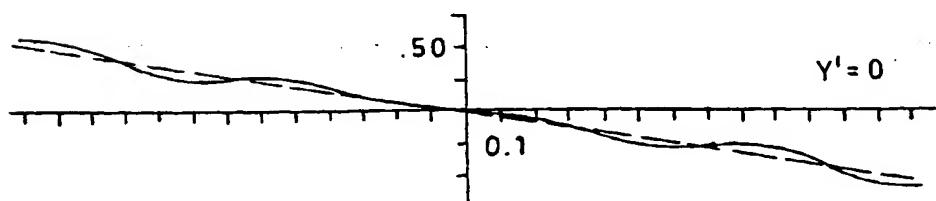


FIG. 5a

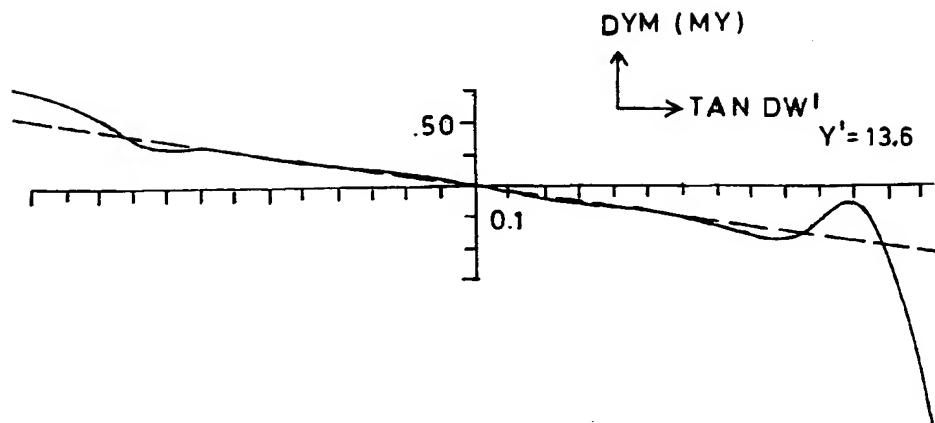


FIG. 5b

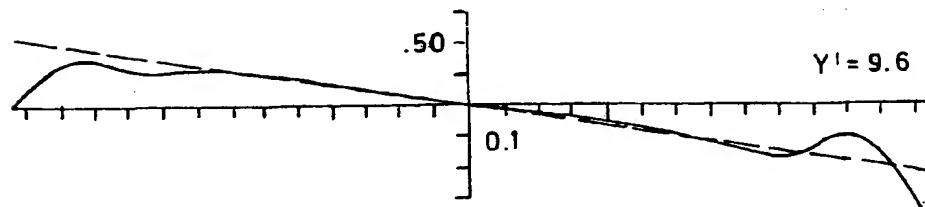


FIG. 5c

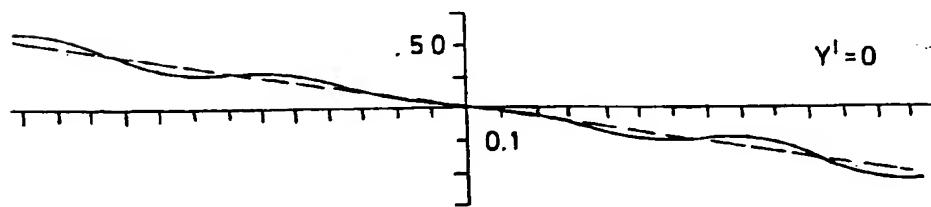


FIG. 6

